ブースNo
T11

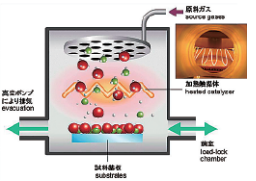
TeSH
Tech Startup HOKURIKU

研究機関概要

【研究代表者】大平 圭介 教授
【部　　署】先端科学技術研究科
【研究開発分野】薄膜形成、太陽光発電

国立大学法人
北陸先端科学技術大学院大学

TEL:0761-51-1563
https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/ohdaira/
〒923-1292
石川県能美市旭台1-1





STEP1

Cat-CVD技術を活用した高性能薄膜の受託製膜プラットフォームビジネス

▶ 事業分野

Cat-CVD技術を活用した高性能薄膜の受託製膜サービスおよび次世代成膜装置事業。

▶ シーズの特徴

触媒化学気相堆積（Cat-CVD）法は、プラズマを用いずに低温･低損傷で高品質な薄膜形成を実現する独自技術である。半導体、太陽電池、OLED、機能性フィルム向けに高性能薄膜を提供できる。受託製膜を通じて顧客課題を解決し、将来的には成膜装置販売およびプロセスライセンス事業へ展開する。

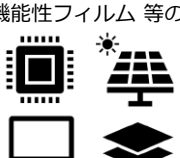
ココがスゴい!

Benefit

次世代デバイス・材料開発を加速

低温･低損傷･高品質な薄膜形成

- 半導体
- 太陽電池
- OLED
- 機能性フィルム 等の研究開発を支援



Difference

Cat-CVD受託製膜拠点

- ☑ プラズマ損傷なし
- ☑ 優れた被覆性
- ☑ 低温プロセス対応
- ☑ 多様な材料・基板に適用

ASK　実証パートナー募集

試作評価のご相談歓迎

- 高品質薄膜試作
- 低温成膜
- 複雑形状への成膜
- 新材料・新デバイス

